

1.	Record Nr.	UNISALENTO991003077339707536
	Autore	Catalano, Franco
	Titolo	La generazione degli anni '40 / Franco Catalano ; introduzione di Raffaele De Grada
	Pubbl/distr/stampa	Milano : Contemporanea, 1975
	Descrizione fisica	147 p. ; 22 cm.
	Disciplina	945.91
	Soggetti	Intellettuali - Italia Italia Cultura 1936-1946
	Lingua di pubblicazione	Italiano
	Formato	Materiale a stampa
	Livello bibliografico	Monografia
2.	Record Nr.	UNISALENTO991004097069707536
	Autore	Rist, John M.
	Titolo	Plotinus : the road to reality / by J. M. Rist
	Pubbl/distr/stampa	Cambridge : Cambridge U.P, 1967
	Descrizione fisica	VII, 280 p. ; 23 cm.
	Disciplina	186.4
	Soggetti	Plotino
	Lingua di pubblicazione	Inglese
	Formato	Materiale a stampa
	Livello bibliografico	Monografia
	Note generali	Bibliografia: p. 270-275.

3. Record Nr.	UNINA9911019632803321
Titolo	Nano-lithography / / edited by Stefan Landis
Pubbl/distr/stampa	London, : ISTE Hoboken, N.J., : Wiley, 2011
ISBN	9781118621707 1118621700 9781118622582 1118622588 9781299315587 1299315585 9781118621622 111862162X
Edizione	[1st edition]
Descrizione fisica	1 online resource (353 p.)
Collana	ISTE
Altri autori (Persone)	LandisStefan
Disciplina	621.3815/31
Soggetti	Nanolithography
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	"Adapted and updated from La nanolithographie published 2010 in France by Hermes Science/Lavoisier"--t.p. verso.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references and index.
Nota di contenuto	Ch. 1. X-ray lithography : fundamentals and applications -- ch. 2. NanoImprint lithography -- ch. 3. Lithography techniques using scanning probe microscopy -- ch. 4. Lithography and manipulation based on the optical properties of metal nanostructures -- ch. 5. Patterning with self-assembling block copolymers -- ch. 6. Metrology for lithography.
Sommario/riassunto	Lithography is an extremely complex tool - based on the concept of "imprinting" an original template version onto mass output - originally using relatively simple optical exposure, masking, and etching techniques, and now extended to include exposure to X-rays, high energy UV light, and electron beams - in processes developed to manufacture everyday products including those in the realms of consumer electronics, telecommunications, entertainment, and transportation, to name but a few. In the last few years, researchers

and engineers have pushed the envelope of fields including optics,
physics,
